Rac'd PCT/PTO 16 SEP 2005

特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

REC'D	2	1	APR	2005
WIPO			F	PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 TU04-0126W01	今後の手続きについては、様式PCT/	IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP2004/001914	国際出願日 (日. 月. 年) 19. 02. 2004	優先日 (日.月.年) 17.03.2003
国際特許分類(IPC)Int.Cl. ⁷ C23C14/	/34, H01L21/28, H01L21/285, H01	IL21/768, C22C9/01, C22C9/02
出願人 (氏名又は名称) 株式会社 日鉱マテリアルズ		

		条に基づきこのE C T 36 条)の規定			国際予備審査報行	告である。	;
2.この国際予備	備審査報告は	、この表紙を含め	て全部で	5	ページからなる	•	
3. この報告に a. V 附属		件も添付されてい 2	ゝる。 ページであ	ు చ			
		この報告の基礎と 図面の用紙(PC)				た訂正を含む明紀	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		が補充概に示した。 機関が認定した差		における国際は	出願の開示の範囲	を超えた補正を含	むものとこの
b. 「 電子 配列 ブル	皮に関する補	・ 充欄に示すように 施細則第 802 号	ニ、コンピュー ^余 照)	夕読み取り可能		(電子媒体の種類、 列表又は配列表に	
4. この国際予例	備審査報告は	、次の内容を含む	P _o	,			
הררה ררה	第I欄 優新 解 I	際予備審査報告の 先権 規性、進歩性又は 明の単一性の欠奴 CT35条(2)に規 るための文献政 る種の引用文献 の場のの不備 の場ので対する意	産業上の利用 l 定する新規性、 [*] 税明				それを娶付
			· <u>·</u>				

国際予備審査の請求書を受理した日 14.07.2004	国際予備審査報告を作成した日 04.04.2005
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官 (権限のある職員) 4G 9278 宮澤 尚之
東京都千代田区設が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3416

第I概	報告の基礎			
	- Farmer (Becke John H.)			
1. C	の国際予備審査報告は、下記	に示す場合を除くほか、	国際出願の言語を基礎	とした。
j I	この報告は、 それは、次の目的で提出され PCT規則12.3及び23. PCT規則12.4にいう PCT規則55.2又は55.	れた翻訳文の言語である 1(b)にいう国際調査 国際公開	5 礎とした。 5。 、	
2. こ た <i>差</i> 替	の報告は下記の出願書類を基 え用紙は、この報告において	- 礎とした。 (法第6条 「出願時」とし、この	(PCT14条)の規定に 報告に添付していない。)	基づく命令に応答するために提出され)
Γ	・ 出願時の国際出願改類			
P	明細書	•		
	第 <u>1-10、12-15</u> 第 <u>11</u> 第			付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
V	history design			
•	第 <u>1-10、12-15</u> 第 第 <u>11、16-18</u>	項*、 項*、	PCT19条の規定に基 14.07.2004	づき補正されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	另		•	付けで国際予備審査機関が受理したもの
	ised had	ページ/図*、 「ル	出願時に提出されたもの) 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
з. Г	補正により、下記の書類が	削除された。		
	厂 明細書 第厂 請求の範囲 第厂 図面 第厂 配列表(具体的に記載			ページ 頃 ページ/図
4. 「	この報告は、補充欄に示し えてされたものと認められ	たように、この報告に るので、その補正がさ	添付されかつ以下に示し れなかったものとして作	た補正が出願時における開示の範囲を超 成した。 (PCT規則 70.2(c))
	□ 請求の範囲 第□ 図面 第□ 配列表(具体的に記載	「 対ること)		ページ 頁 ページ/図
* 4.	に該当する 場合 、その用紙に	. "superseded" と記入	されることがある。	

第Ⅲ	概 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
	次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により 審査しない。
Г	国際出願全体
V	請求の範囲 11-13、16-18
理由	
V	記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。 第四欄で示したとおり、請求の範囲11および16は、その構成が不明瞭であるから、請求の
	範囲11~13および16~18に記載された発明を把握できない。 よって、請求の範囲11~13および16~18に対して見解を示すことができない。
	よって、晴水の範囲エー・13んよび10~10に対して允许を小りことができない。
Γ	全部の請求の範囲又は請求の範囲が、明細書による十分な
	裏付けを欠くため、見解を示すことができない。 ************************************
į	請求の範囲について、国際調査報告が作成されていない。
	ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が、実施細則の附属 書 C (塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン) に定める基準を、次の点で満たしていない。
	書面による配列表が 提出されていない。
	「
Г	コンピュータ読み取り可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表に関連するテーブルが、実施細則の附属書 Cの2に定める技術的な要件を、次の点で満たしていない。
	「
Γ	詳細については補充欄を参照すること。

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/001914

見解		
新規性(N)	請求の範囲 <u>1-10、14、15</u>	有
	請求の範囲	
進歩性(IS)	請求の範囲 1-10、14、15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	請求の範囲	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-10、14、15	, 有
•	請求の範囲	

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1:JP 2002-4048 A (株式会社荏原製作所) 2002.01.09

文献2:JP 2001-284358 A (富士通株式会社) 2001.10.12

文献3:JP 2002-294437 A (三菱マテリアル株式会社) 2002.10.09

文献4:JP 11-158614 A (日立金属株式会社) 1999.06.15

(1)請求の範囲1~10、14、15は、国際調査報告で引用された文献に対して進歩性を有する。上記文献には、「Al又はSnから選んだ少なくとも1元素を0.01~0.5(未満)wt%含有し、かつMn又はSiのいずれか一方又は双方が総量で0.25wtppm以下含有すること」が記載されておらず、一方、本願発明はそれにより、「シート抵抗が小さくかつ凝集がなく、安定で均一なシード層を形成」できるという有利な効果を発揮する。

第四個 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

(1)請求の範囲11には、「Al又はSnから選んだ少なくとも1元素を0.01~0.5(未満)wt% 含有し、かつMn又はSiのいずれか一方又は双方が総量で0.25wtppm以下含有することを特徴とする銅合金スパッタリングターゲットのスパッタ膜」と記載されている。

当該記載は、「AI又はSnから選んだ少なくとも1元素を0.01~0.5(未満)wt%含有し、かつMn又はSiのいずれか一方又は双方が総量で0.25wtppm以下含有することを特徴とする 銅合金ターゲット」を用いたスパッタリングにより形成された膜を示しているものと認められる。しかしながら、同じターゲットを用いてもスパッタ条件等により得られる膜の組成や物性等は変化するものであるから、「AI又はSnから選んだ少なくとも1元素を0.01~0.5(未満)wt%含有し、かつMn又はSiのいずれか一方又は双方が総量で0.25wtppm以下含有することを特徴とする銅合金ターゲットの」との表現で修飾されている「スパッタ膜」が具体的にどのようなものを示すものなのか不明瞭である。

(2)請求の範囲16についても(1)で示した同じ理由により、不明瞭である。

表1

膜厚均一性 (3σ%)	17	15	20	12	8	15	13	11	16	13	13	6	14		21	18	13	25	
	凝集性極めて低い	凝集性極めて低い	凝集性なし	凝集性なし	凝集性なし	凝集性極めて低い	凝集性極めて低い	凝集性極めて低い	凝集性なし	凝集性なし	凝集性強い	凝集性あり	凝集性あり		凝集性強い	凝集性あり	凝集性強い	凝集性低い	
粒径バラツキ 凝集性 (%)	19	13	16	13	16	17	18	18	19	13	15	6	11		17	15	18	29	, As合計
平均粒径 (μm)	96	70	85	46	61	52	36	61	44	27	63	22	43		91	43	63	19	*Sb, Zr, Ti, Cr, Ag, Au, Cd, In, As合計
酸素 (ppm)	< 5	~ 5	⊽	V	- V	~ 5	√ 5	-	\ \ -	-	< 5	^5	\ \ \ \		< 5	\ \ \ \ \	\ \ \	<u>₽</u>	Ti, Cr, A
*Sb绑 (bpm)	0.13	0.25	0.16	0.32	0.32	0.26	0.29	0.16	0.46	0.32	0.17	0.34	0.53		0.22	0.23	0.71	0.55	*Sb, Zr,
Mn(ppm)	<0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.05	0.03	0.17	0.10	0.22	0.21	< 0.001	0.13	0.05		0.03	0.75	0.45	0.22	
Si(ppm)	0.05	0.07	60.0	0.11	0.19	< 0.01	0.05	0.03	< 0.01	< 0.01	0.03	0.61	0.36		< 0.01	0.03	0.05	< 0.01	
AI、Sn濃度(目標組成)	0. 02wt%AI	0. 05wt%AI	0. 106wt%AI	0. 213wt%Al	0. 427wt%AI	0.02wt%Sn	0. 05wt%Sn	0. 1wt%Sn	0. 25wt%Sn	0. 5wt%Sn	0.008wt%AI	0.86wt%AI	0. 213wt%AI	削除	0.005wt%Sn	1. 0wt%Sn	0. 25wt%Sn	0. 5wt%Sn	
	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9	実施例10	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5	比較例6	比較例7	比較例8	

9. Na、Kがそれぞれ0.02wtppm以下、U、Thがそれぞれ0.5 wtppb以下、酸素1wtppm以下、窒素1wtppm以下、炭素1wtppm以下、炭素1wtppm以下であることを特徴とする請求の範囲第8項記載の銅合金スパッタリングターゲット。

5

20

- 10. 平均結晶粒径が 100μ m以下であり、平均粒径のばらつきが $\pm 20\%$ 以内であることを特徴とする請求の範囲第 1 項~第 9 項のいずれかに記載の銅合 金スパッタリングターゲット。
- 11. (補正後) Al又はSnから選んだ少なくとも1元素を0.01~0.5 (未満) wt%含有し、かつMn又はSiのいずれか一方又は双方が総量で0.25wtppm以下含有することを特徴とする銅合金ターゲットのスパッタ膜からなる半導体素子配線。
 - 12. 半導体素子配線のシード層として形成されることを特徴とする請求の範囲第11項記載の半導体素子配線。
- 15 13. Ta、Ta合金又はこれらの窒化物のバリア膜上にシード層として形成されることを特徴とする請求の範囲第12項記載の半導体素子配線。
 - 14. 添加元素の母合金を作製し、これを銅又は低濃度母合金の溶湯に溶解してインゴットとし、このインゴットを加工してターゲットとすることを特徴とする請求の範囲第1項~第10項のいずれかに記載の銅合金スパッタリングターゲットの製造方法。
 - 15. 固溶限以内の母合金を作製することを特徴とする請求の範囲第14項記載の銅合金スパッタリングターゲットの製造方法。
 - 16. (追加) A I 又はS n から選んだ少なくとも 1 元素を 0. 0 1 \sim 0. 5 (未満) w t %含有し、かつM n 又はS i のいずれか一方又は双方が総量で 0.
- 25 25wtppm以下含有する共に、さらにSb, Zr, Ti, Cr, Ag, Au, Cd, In, Asから選択した1又は2以上を総量で1.0wtppm以下含有することを特徴とする銅合金ターゲットのスパッタ膜からなる半導体素子配線。
 - 17. (追加)半導体素子配線のシード層として形成されることを特徴とする請求の範囲第16項記載の半導体素子配線。
- 30 18. (追加) Ta、Ta合金又はこれらの窒化物のバリア膜上にシード層として形成されることを特徴とする請求の範囲第17項記載の半導体素子配線。

Rec'd PCT/PTO 16 SEP 200 PCT/JP2004/0015

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

	(FCT AILIC	le 30 and Rule 70)					
Applicant's or agent's file reference TU04-0126WO1	FOR FURTHER	ACTION	See Form PCT/IPEA/416				
International application No. PCT/JP2004/001914	19 February 20	late (day/month/year) 004 (19.02.2004)	Priority date (day/month/year) 17 March 2003 (17.03.2003)				
International Patent Classification (IPC) or na C23C 14/34, H01L 21/28, 21/285	ational classification a 5, 21/768, C22C 9/0	and IPC 01, 9/02					
Applicant	NIKKO MATEI	RIALS CO., LTD.					
This report is the international prelim Authority under Article 35 and transr	ou to the applicant	according to Article 36	•				
This REPORT consists of a total of This report is also accompanied by A	5 sheets	s, including this cover sh	eet.				
a. (sent to the applicant and t			sheets, as follows:				
sheets of the descri and/or sheets conta Administrative Inst		frawings which have been thorized by this Author	en amended and are the basis of this report ity (see Rule 70.16 and Section 607 of the				
sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.							
b. (sent to the International	al Bureau only) a	total of (indicate type ining a sequence listing nental Box Relating to	e and number of electronic carrier(s)) and/or tables related thereto, in computer Sequence Listing (see Section 802 of the				
4. This report contains indications relating	ng to the following ite	ms:					
Box No. I Basis of the repo	ort						
Box No. II Priority Box No. III Non-establishme	_						
Box No. IV Lack of unity of	ent of opinion with re	gard to novelty, inventiv	e step and industrial applicability				
Box No. V Reasoned statem citations and exp	ent under Article 35(planations supporting	2) with regard to novelty such statement	, inventive step or industrial applicability;				
Box No. VI Certain documer Box No. VII Certain defects in	•						
	n the international appoint in the internation on the internation						
Date of submission of the demand		Date of completion of t	his report				
14 July 2004 (14.07.200)4)		pril 2005 (04.04.2005)				
Name and mailing address of the IPEA/JP		Authorized officer					
Facsimile No.		Telephone No.					

Translation

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2004/001914

Box No	. 1 B	asis of the report		
1. With other	regard t	o the language, this report is base icated under this item.	ed on the international application in the lang	uage in which it was filed, unless
	This rewards	eport is based on translations fro is language of a translation furni	om the original language into the following shed for the purpose of:	language,
		nternational search (under Rules	- -	
		publication of the international ap	* **	
	_		ation (under Rules 55.2 and/or 55.3).	
			(**************************************	
jurnu	re not a	to the elements of the internat the receiving Office in response to nnexed to this report): ernational application as original	ional application, this report is based on (ito an invitation under Article 14 are referreally filed/furnished	replacement sheets which have been to in this report as "originally filed"
\boxtimes		cription:		
	pages		1-10, 12-15	, as originally filed/furnished
	pages*	11	received by this Authority on	14 July 2004 (14.07.2004)
	pages*		received by this Authority on	
	the clai	ms:		
	pages		1-10, 12-15	, as originally filed/furnished
1	pages*			ther with any statement) under Article 19
	pages*	11, 16-18	received by this Authority on	14 July 2004 (14.07.2004)
	pages*		received by this Authority on	
	the drav	wings:		
	pages			, as originally filed/furnished
	pages*		received by this Authority on	, as originary integral monoc
	pages*		received by this Authority on	
	a seque	nce listing and/or any related table	le(s) – see Supplemental Box Relating to Seq	yanga I isting
	_	,		·
3.	The am	endments have resulted in the car	noclistics of	
		ne description, pages		
1		ne claims, Nos.		
1	a	ny table(s) related to sequence lis	sting (specify):	
4. []	(Rule 7	0.2(c)).	some of) the amendments annexed to this replication to go beyond the disclosure as filed, as in	port and listed below had not been ndicated in the Supplemental Box
	片"	te description, pages		
ĺ				
	a	ny table(s) related to sequence lis	sting (specify):	
ł				
* If iten	n 4 appli	ies, some or all of those sheets mo	ay be marked "superseded."	
<u> </u>				

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP2004/001914

III. Non-establishment of	opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
The questions whether industrially applicable h	the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be ave not been examined in respect of:
the entire intern	ational application.
Claims Nos	11-13, 16-18
because:	
the said internat	ional application, or the said claims Nos.
relate to the folio	owing subject matter which does not require an international preliminary examination (specify):
	·
the description	Naima on dequines (c. di
the description, of are so unclear the	claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos
As explained in Box	x VIII, because the constitutions of claims 11 and 16 are unclear, the inventions
of claims 11-13 and 1	6-18 cannot be understood.
incretore, an opinio	on cannot be given concerning claims 11-13 and 16-18.
	\cdot
the claims, or said	d claims NT-
by the description	n that no meaningful opinion could be formed.
no international s	earch report has been established for said claims Nos.
	· ·
2. A meaningful internation	al preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid
	y with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions: nas not been furnished or does not comply with the standard.
L uie computer reac	lable form has not been furnished or does not comply with the standard.
POTTER A MAD OF THE	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP2004/001914

tement			
Novelty (N)	Claims	1-10, 14, 15	YE
•	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-10, 14, 15	YE
	Claims		NO.
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10, 14, 15	YE
	Claims		NC

2. Citations and explanations

Document 1: JP, 2002-4048, A (Ebara Corp.), 09 January, 2002 Document 2: JP, 2001-28458, A (Fujitsu Ltd.), 12 October, 2001

Document 3: JP, 2002-294437, A (Mitsubishi Materials Corp.), 09 October, 2002

Document 4: JP, 11-158614, A (Hitachi Metals, Ltd.), 15 June, 1999

(1) Claims 1-10, 14, and 15 appear to involve an inventive step over the documents cited in the ISR. The documents do not describe "at least one element selected from among Al and Sn is contained in an amount of 0.01 to less than 0.5 wt.% while the total amount of Mn and Si is not greater than 0.25 wt.ppm." At the same time, the invention of the present application realizes the advantageous effect of thereby being able to "form a stable homogeneous seed layer free from aggregation and with low sheet resistance."

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2004/001914

Box No. VIII Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

(1) Claim 11 describes a "copper alloy sputtering target characterized in that at least one element selected from among Al and Sn is contained in an amount of 0.01 to less than 0.5 wt.% while the total amount of Mn and Si is not greater than 0.25 wt.ppm."

This description is found to describe a film formed by sputtering wherein a "copper alloy target characterized in that at least one element selected from among Al and Sn is contained in an amount of 0.01 to less than 0.5 wt.% while the total amount of Mn and Si is not greater than 0.25 wt.ppm However, even if the same target is used, the composition and physical characteristics, etc. obtained will differ depending on spatter conditions, etc.; therefore, it is unclear what kind of thing "spatte film" refers to when modified by the expression "copper alloy target characterized in that at least or element selected from among Al and Sn is contained in an amount of 0.01 to less than 0.5 wt.% whithe total amount of Mn and Si is not greater than 0.25 wt,ppm."
(2) Claim 16 is unclear for the same reasons as explained in (1).
·